

2010年6月18日

日立ハイテック社長の大林秀仁が「IEEE Ernst Weber Engineering Leadership Recognition」を受賞 —日本人で初、測長 SEM の開発推進で半導体の微細化に貢献—

株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役社長である大林秀仁は、このたび IEEE（米国電気電子学会）（*1）より、「2010 IEEE Ernst Weber Engineering Leadership Recognition」を受賞することになりました。本賞は 1985 年に創設、IEEE の初代プレジデントである Ernst Weber 氏の栄誉を称えて 1996 年に現在の名称に改称された賞で、電気工学の分野においてリーダー的な役割を果たした個人に贈られるものです。なお、大林は日本人で初めての同賞受賞者となります。

大林は、微細化が進んだ半導体デバイスの回路パターンの寸法を正確に測定するために、従来の光学式顕微鏡に替わり走査型電子顕微鏡（SEM）を応用することを提案、1980 年代に世界初の測長 SEM（*2）を開発しました。1996 年からは東京大学で特別講師として「電子顕微鏡の原理と応用」について講義を行っているほか、社団法人日本半導体製造装置協会（SEAJ）副会長（2008 年～現任）を務め、2007 年度には「半導体超微細パターン計測用測長 SEM の開発と実用化」で大河内記念生産賞を受賞するなど、測長 SEM の開発と普及に貢献してきました。

このたび、大林は、走査型電子顕微鏡分野、特に大規模集積回路（LSI）の開発・製造に不可欠な測長 SEM の研究開発における「お客様と共に、そして、お客様より一步先に」を信条としたリーダーシップが評価され、本賞を受賞することになりました。測長 SEM は、パターンの微細化の進展による高性能化と生産歩留り管理に不可欠な計測装置として、世界中の半導体デバイスの開発および量産ラインで使用されています。

なお、授賞式は 2010 年 6 月 26 日にカナダ・ケベック州モンリオールの IEEE Honors Ceremony において行われます。

（*1）Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.（米国電気電子学会）は、世界 160 ヶ国以上に 39 万 5 千人以上もの会員を有する世界最大の技術国際学会です。

（*2）Critical Dimension Scanning Electron Microscope

【大林社長受賞コメント】

開発を支援していただき、長きにわたってお使いいただいている全世界の測長 SEM ユーザーの皆さま、そして、お客さまの声を真摯に受け止め続けた測長 SEM の開発、営業、サービス担当者のおかげで、栄えある「IEEE Ernst Weber Engineering Leadership Recognition」を受賞することができたことを感謝いたしております。



株式会社日立ハイテクノロジーズ 執行役社長 大林秀仁

■報道機関お問い合わせ先

社長室 広報・IR グループ 担当：松本、丸山 TEL：03-3504-3258